

半導體光學微影技術核心課程

■ 課程介紹

台灣半導體產業是科技產業的核心，持續需要優秀科技人才投身此高科技產業。半導體製程的核心是光學微影技術，光學微影技術的核心是光學原理的應用。半導體製程中要將晶片上的電路更縮小化，就需要更短波長的雷射光源，或是使用浸潤式光學微影製程等方式，以便在光刻製程中，用雷射光刻出間距更小的電路圖。光線的波長決定了焦點的尺寸，也就決定了電路的線距。現今半導體製程往 7 奈米以下邁進，便需要用更短的波長製作更精細、密度更高的電路，從而構建更快、更節能的晶片。

本課程採用台積電資深副總林本堅(Burn Lin)博士的經典著作，“Optical Lithography-Here Is Why” 為參考教材，講授半導體光學微影技術光學原理的應用，協助半導體產業研發及專案管理人員了解光刻機的核心技術，同時歡迎電機、機械、光電等產業在職人士參與本課程，增加跨領域學習機會。

■ 課程目標

瞭解光刻機的核心技術-半導體光學微影技術光學原理的應用。

■ 課程對象

半導體產業技術研發人員、專案管理人員或研發主管。

■ 課程大綱

- 光刻機技術發展歷程
- 光刻機重要的指標參數
- 繞射極限的物理意義
- 解像能力與焦深的選擇
- 空間頻率的概念
- 光源同調性的影響

■ 講師簡介

林世穆 講師

- **現職：**
瑞光科技顧問有限公司 資深顧問
- **學歷：**
英國雷丁大學 物理系應用光學組博士
英國倫敦大學 帝國理工學院物理系應用光學組碩士
- **經歷：**
國立台北科技大學光電工程系專任副教授
- **專長：**
光學鏡頭設計、光學系統設計、ZEMAX 教學

【 報名資訊 】

主辦單位：工研院產業學院

舉辦日期：110年5月6日(四)·上午09:00~12:00、下午13:00~16:00·共6小時。

舉辦地點：工研院光復院區1館(詳細地點請以上課通知為準)

課程費用：(含稅、午餐、講義)

課程方案	費用
每人	5,200 元
110/4/22(含)前報名享優惠價·每人	4,700 元
同公司2人(含)團報優惠價·每人	4,700 元
工研人享優惠價	4,700 元

報名方式：

1. 線上報名：點選課程頁面上方之「線上報名」按鈕，填寫報名資訊即可。
2. 傳真報名：請將報名表傳真至(03)5750690 黃小姐(傳真後請來電確認，以保障報名權益)
3. 電郵報名：洽黃小姐(03-5732034；E-mail：itri535579@itri.org.tw)、王先生(03-5732774；E-mail：joseph_wang@itri.org.tw)

註：報名後待確定開課時，課務人員會再通知學員進行繳款及提供課程詳細地點等課務資訊。

注意事項：

1. 為確保您的上課權益，報名後若未收到任何回覆，敬請來電洽詢方完成報名。
2. 若您不克前來，請於開課三日前告知，以利行政作業進行。
3. 若原報名者因故不克參加，但欲更換他人參加，敬請於開課前二日通知。



4. 學員於開訓前退訓者，將依其申請退還所繳上課費用 90%，另於培訓期間若因個人因素無法繼續參與課程，將依上課未逾總時數 1/3，退還所繳上課費用之 50%，上課逾總時數 1/3，則不退費。
5. 為尊重講師之智慧財產權，恕無法提供課程講義電子檔。